

# plameco

## Niederdruck-Plasma PVD-Beschichtungsanlage für Pulver, Fasern und lose Teile

Die Plameco-Anlage ermöglicht kontrollierte Beschichtungen auf Pulver und Kleinstteilen mit Hilfe eines Plasma-Magnetron-Sputterverfahrens. Die Anlage ist mit zwei großen Kathoden und einem drehbaren Zylinder ausgestattet, um die Effizienz und Homogenität der Beschichtung zu gewährleisten. Verschiedene Beschichtungsmaterialien und Gase können verwendet werden, um die gewünschte Beschichtung zu erzielen.



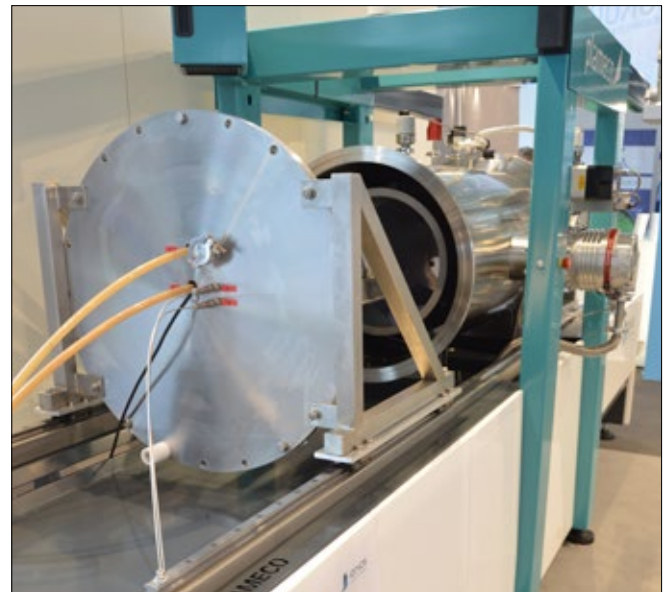
Designed by ionics

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Allgemeine Leistung: 400 V / 32 A DC, AC oder gepulste Stromversorgung 5 Kw (2x5 Kw) Eingang 400 V Ausgang 325-800 V 2x15 A
Gasfluss	von 0 bis 100 Sccm
Druckbereich	unter $1,3 \cdot 10^{-6}$ mbar
Größe der Kathoden	63 x 750 mm (rechteckig) 2-Zoll / 51 mm (kreisförmig)
Substratgröße	von wenigen Mikrometern bis zu einigen Zentimetern
Verarbeitungskapazität	Chargen bis zu 5 Litern
Abmessungen der Maschine	L4150xB1300xH2100 mm
Gewicht	+/- 750 kg
Wasser-Kühlsystem	Ja - Wasserkühler 1,5 m <sup>3</sup> /Std. - Kaltleistung von 4525 W für Wasser bei 15°C

### Eigenschaften

- ▲ Beschichtungsquellen: PVD-Plasma-Sputtern
- ▲ Zwei Magnetron-Kathoden
- ▲ Vollständig integriertes automatisches Steuerungssystem
- ▲ Jedes Gas kann verwendet werden: Ar, He, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, SiH<sub>4</sub> sowie Mischungen



### Anwendungen

#### ▲ Auf Pulvern/Diamanten

Pulvermodifikation für AM, 3D-Druck, Katalysatoren, Spritzguss und Sinterverfahren, thermisches Spritzen,...

#### ▲ Auf Fasern

Behandlung von Fasern für Verbundwerkstoffe, Filtration, GO-Polymere und Batterien.

#### ▲ Auf losen Teilen/Kugeln

Behandlung loser Teile für neue Oberflächenfunktionalitäten und verbesserte Haltbarkeit.